



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03018806 A

(43) Date of publication of application: 28.01.1991

(51) Int. CI

G02B 6/42

H01S 3/18

(21) Application number:

01152211

(22) Date of filing:

16.06.1989

(71) Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP < NTT>

(72) Inventor:

TERUI HIROSHI

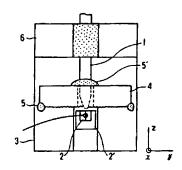
(54) SEMICONDUCTOR LASER MODULE

(57) Abstract:

PURPOSE: To accurately position the above module with high accuracy of submicron order at a high yield by specifying the center line average surface roughness of the adhering surfaces of 1st and 2nd fixing blocks.

CONSTITUTION: The center line average surface roughenes Ha on the adhering surfaces of the 1st fixing block and the 2nd fixing block is specified to $0.3\mu m < Ha < 6.0\mu m$. The average surface roughness Ha of the adhering surfaces of the 1st, 2nd fixing blocks 3, 4 is maintained in the specified range in such a manner, by which adhesives 5, 5' infiltering the spacing between the two fixing blocks 3, 4 are prevented from acting as a lubricant. Sufficient friction force is obtd. when the two fixing blocks 3, 4 are brought into pressurized contact with each other. The generation of the misregistration at the time of the shrinkage of the adhesives 5, 5' on curing is prevented in this way.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平3-18806

Mint. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

63公開 平成3年(1991)1月28日

G 02 B 6/42 H 01 S 3/18 8507-2H 7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 半導体レーザモジュール

②特 顧 平1-152211

②出 頤 平1(1989)6月16日

创発 明 者 照 井

博 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

创出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

四代 理 人 弁理士 中村 純之助

明 相 群

- 発明の名称
 半導体レーザモジュール
- 2. 特許請求の範囲

特部とを有する半導体レーザモジュールにおいて、上記第1と第2の固定用ブロック接着 個の中心線平均表面組さHaが、

0.3 μm < H a < 6.0 μm

であることを特徴とする半導体レーザモジュ ール

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光通信や光情報処理の分野で、光源 として用いられるファイバ付半導体レーザモジュ ールに関するものである。

(従来の技術)

ファイバ付半導体レーザモジュールとしては、 第2回に示すような先球光ファイバ1を用いたものが検討されている(特閣昭63-309879 号公根)。上記先球光ファイバ1は半導体レーザ (LD) 2との結合効率として、2~4dBと高 結合効率が得られるため、これを用いれば、安価 でかつ小型高性能なファイバ付半導体レーザモジュールが実現できる。しかし、上記先球光ファイ パ1を用いる方法は、位置決の固定に高精度を要 するという問題があった。第3回および貫4週は、 免摄波员1.3 m. 放射半額全角(FWHM) 81 (第2回のx方向) 8~(第2回のy方向) が各 430点、23度のInGaAsP半羽体レーザ2 と、先媼球半径R=10mの先球光ファイバト (ポーモード) との結合効率の距離仏存性を示す 図である。第3図は光韓方向(2韓)の距離依存 性であり、半退体レーザ2と先球ファイバ1との 距離Δz=11μで及大結合効率(56%、 2.5dB) が待られ、1dBトレランス(1dB劣 化許容位置ずれ量)は第3回から土4,5mであ ることがわかる。一方、第4図はΔェ=11μの 場合の光韓に重直な方向(第2回におけるx, y 方向)の結合効率の距離依存性である。図から明 らかなように 1 d B トレランスは±0.8 mである。 光値方向の14Bトレランス±4.5 畑は、はんだ

夏米されるため、第2回に示す従来例ではつぎに 示すような工夫をしていた。すなわち、第2因に 示すように、半導体レーザ2の近辺に属体7と一 体化された第1の固定用プロック3を収け、一方、 先球ファイバ1の側にも先端のレンズ部近げを、 光ファイバ博入固定穴に接着削5 * で接着した第 2の固定用ブロック4を設けている。位置合わせ 作業ののち、図の一1方向に先球ファイバーを抑 付けて、第1の固定用ブロック3に第2の固定用 ブロック4を圧着固定し、その後両周定用ブロッ ク和を接着用5で固定していた。すなわち、位置 固定作業時の接着剤の硬化収縮等に起因する位置 ずれを、上記両ブロック3および4間の承依力に よって防止しようとするものであった。第2の光 ファイパ保持郎6は、系外からの外力がファイバ を介して先端レンズ部に及ぶのを防ぐためのもの である.

〔尭明が解決しようとする課題〕

上記従来技術においてはつぎのような問題があった。すなわち第5回に示すように、第1の固定

用ブロック3に第2の固定用ブロック4を圧才協定したのち、両ブロック間に接着利5を始布すると、表面張力によって接着利5が両ブロック3、4の間に入り込み、これが調滞剤の作用をして両ブロック間の原体力を著しく低級させてしまうという問題点があった。したがって、接着用が似化する過程で位置ずれを生じやすく、製品少留りがよくなかった。

あるいは接着剤や消接等を用いた位置決め固定作

糞で十分実現できる。 しかし、光軸に重直な方向

についてはサブミクロン (±0.8 m) の特度が

本発明は、先球光ファイバと半導体レーザとの 間に位置決めが高額度にでき、安価で小型、かつ 高性館なファイバ付半導体レーザモジュールを刊 ることを目的とする。

[最近を解決するための手段]

上記目的は、 野1の固定用ブロック3と野2の固定用ブロック4との接着面における、中心線平均表面組さHaを0.3 m <Ho<6.0 mとすることにより達成される。

(作用)

世来技術では第1の固定用ブロックと第2の固定用ブロックとの協力画を、平面に仕上げて圧着

因定したのち接着していたが、第1 および 第2 の 固定用プロック間の摩擦力が十分でなく、接着剤が硬化収納する際に位置ずれを生じていたが、本 類明では上記 第1 と 第2 の固定用プロック接着面 の平均 没面 組 さを一定 範囲に保持したために、両 固定プロックの 標間に 浸入した接着剤が潤滑 別と なることなく、上記の両 固定用プロックを圧着す ることにより十分な摩擦力が得られ、接着剤の硬 化収縮に際して位置ずれが生じるのを助止することができる。

(実施例)

つぎに本発明の実施例を図面とともに説明する。
第1図は本発明による半導体レーザモジュールの一実施例を示す平面図である。まず、剣ータングステン(Culo%-W90%)合金の角棒を、切削加工によって第1図に示すように、類1の固定用ブロック3および第2の光ファイパ固定部6が一体化された検盗の形状に加工したのち、上記第1の固定用ブロック3の接着面以外の部位に金メッキを施して関体7を作製した。一方、厚さ

300㎞の石英板に超音波加工もしくはCO.レ ーザ加工によって直径150~200mの光ファ ィバ保持用穴をあけた第2の固定用ブロック4を 作裂した。つぎに、上記第1および剪2の因定用 ブロックの接着面に、粒皮#3000~4000 希のダイヤモンド扮末の噴射加工を施し、所望の 組さに加工した。つぎに発想改長1.3 m. 放射 半恆全角(FWHM) 0... 0.が各々30度、2 3度のInGaAsPレーザ2をヒートシンク2' を介して上記国体7の所定の卸位に、第1国のよ うに設置した。つぎに上記レーザ2の発光面を上 にして敬助台上に重力方向に平行に120回し、第1 の固定用プロック3の接着面上に、「飢2の固定用 ブロック4である光ファイパ保持用穴を有する石 英板を、接着面を下にして置いた。つぎに重力方 向と平行に微助台に設配した先球ファイバ1を、 上方が、新2の固定用ブロック4の光ファイバ固定 用穴を通し、半導体レーザ2との最適結合位置に 合わせたのち、氪2の固定用ブロック4である石 英板のファイバ固定用穴に、エポキシ樹脂もしく

は無外線項化製品を注入項化させ、先球ファイバ1と第2の固定用ブロック4を接着した。つぎに再度最大結合効率に顕然した後、先球ファイバ1を 1 種のマイナス方向に変位させ、第2の固定用ブロック3に圧射した・可固定用ブロック3、4間にエポキン製品もしくは繋外線硬化製船を注入硬化させて、半退体レーザ2と先球ファイバ目の位置の6に接着場体レーザを設めて、ファイバ付半退体レーザモジュールを完成した。

上記過程に基づいて、第1、第2の固定用プロックの接着面における裏面組さを変えたモジュールを10種類作数し、半導体レーザ2と先線ファイバ1との結合効率の変化を関べた。10種類のモジュールの接着面における中心線平均組されるはつぎの通りである。Ha=0.01、0.3、0.5、0.9、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0 血(中心線平均組さは、「機械光学便覧」日本機械学会著ならびに発行、昭和48年

6月15日発行、pp.17~176秒照)。その結果、接着面の中心線平均粗さHeが0.3をこえ0.6 m未満のサンプルでは、結合効単の変化が観測されなかった。一方、Haが0.3 m未満の場合は、両固定用ブロックを圧着固定する工程では結合効率の低下がなかったが、周固定用ブロック間に接着剤を注入硬化させる工程で0.3~0.9 dBの結合効率低下が観音れた。また、Heが6mを超える場合は、両固定用ブロックの圧力工程で0.3~1.5 dBの結合効率の低下が観られたが、接着剤注入硬化工程では結合効率の低下が取られたが、接着剤注入硬化工程では結合効率の低下がなかった。以上の結果から、接着面の表面型さHeを0.3~0.6 mの間に設定すれば、無変位固定を実現できることが判った。

(発明の効果)

上記のように本発明による半導体レーザモジュールは、国体の所定の位置に設置した半導体レーザと、先端にレンズ部を僻え、上記半導体レーザと光学的に結合した先球光ファイバと、上記半導体レーザの近径に光軸と返函な換着面を有し、か

つ上記接着面が上記半導体レーザの発光面よりも 所定の距離だけ前方に位置するように設置した第 1の固定用プロックと、光軸に平行な光ファイバ **挿入協定穴と光軸に重直な接着値を傾え、上記接 券前が新しの固定用プロックに固定されるととも** に、上記光ファイバ挿入園定穴に接着剤で上記先 球光ファイバのレンズ部近傍を保持した、邓2の 固定用プロックとからなる剪しの光ファイバ保持 部と、該第1の光ファイバ保持部より所定の距離 だけ前方に設けた第2の光ファイパ保持部とを有 する半退体レーザモジュールにおいて、上記第1 と第2の固定用プロック接着面の中心線平均表面 狙さHaが、0.3 mくHaく6.0 mであることに より、サブミクロン特度の高精度な位置決めが、 少句りよく実現することができる。また、第1、 第2両囚定用プロック間の接着剤に対する面観が 昭えるため、接着強度が増し信頼性を高めること ができ、高性値でかつ安価なファイバ付半導体レ ーザモジュールを得ることが可能である。

4. 図面の簡単な説明

野1回は本籍明による半海体レーザモジュールの一実庭例を示す平面図、第2図は従来の半海体レーザモジュールを示す料視図、第3図は本発明レーザと先はファイバとの結合効率の光効に平行な方向の距離依存性を示す図、第4図は半海体レーザと先はファイバとの結合効率の光端に重直な方向の距離依存性を示す図、第5図は従来モジュールにおける接着利の強布状況を示す図である。

1…先球光ファイバ 2…半導体レーザ

3…第1の固定用プロック

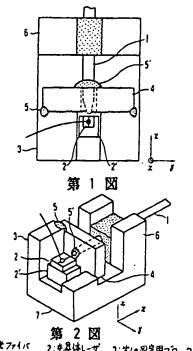
4… 52の固定用プロック

5、5′…接着刺

6… 節2光ファイバ保持部

7…Ц体

特許由領人 日本沿自公部体式会社 代理人并理士 中村 纯之助



1: 法球光ファイバ 2: 中身体レーザ 3: オノー 国文用プロック 4: オスー国定用ブロック 5,5 : 持着剤 6: オスモファイバ保持部 7: 医体

